## RECENT PROGRESS OF A HIGH RESOLUTION BEAM PROFILE MONITOR USING ZONE PLATES

Hiroshi Sakai<sup>\* A)</sup>, Norio Nakamura<sup>A)</sup>, Hitoshi Hayano<sup>B)</sup>, Toshiya Muto<sup>B)</sup> <sup>A)</sup> ISSP, University of Tokyo, 5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, 277-8581 <sup>B)</sup> KEK, 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

#### Abstract

We present the recent progress of the FZP (Fresnel Zone Plate) beam profile monitor constructed at KEK-ATF damping ring. This monitor based on an X-ray imaging optics with two FZPs <sup>[1]</sup>. In this monitor, the transverse electron beam image at bending magnet is twenty-times magnified by the two FZPs and detected on an X-ray CCD camera. The expected spatial resolution is less than  $1\mu$ m. Recently, we install the new mechanical shutter in order to avoid the unexpected 100Hz vibration. By applying this shutter, the shutter opening time was reduced less than 1ms and the 100Hz vibration could be neglected on the beam profile measurement. In this paper, we report the new shutter performance and the measurement results of beam profile by the improved FZP beam profile monitor.

# ゾーンプレートを用いた高分解能ビームプロファイルモニタ開発の現状

## 1. はじめに

KEK-ATF ダンピングリングはリニアコライダ用 の超低エミッタンスビームを生成するリングであり、 ビームサイズは水平方向約 50µm、垂直方向 10µm以 下である。本モニター(以下「FZPモニター」)はこの ような極小ビームのプロファイルをモニターするた めに建設されたものである。FZPモニターの全体図を 図1に示す。このモニターは2つのフレネルゾーンプ レート(以下「FZP」)で構成される X線結像光学系 を基本とし、電子ビームからの放射光を Si 結晶分光 器にて 3.235keV の X線に単色化し、2つの FZP(図 1 中の"CZP","MZP")にて、X線 CCD カメラに結像 する。これにより CCD 上では2 0 倍に拡大したビー ムイメージが得られ、空間分解能ではガウス分布で サブミクロンレベルに設計されている<sup>[2]</sup>。

これまでの経緯として、2002年にモニター用のビー ムラインが建設され、本モニタにて、10µm以下のビー ムプロファイルが測定された<sup>[1]</sup>。その後、Si分光器 のドリフトの抑制及び安定化を行い、X線の光軸の 安定化により、長期に渡り、安定な測定が可能になっ た<sup>[3]</sup>。また CZP、MZP のホルダーを抜き差し可能に 改善することにより、SR 光を直接 CCD 上にて測定 が可能になり、X線の光軸のアラインメントが飛躍 的に向上した。その結果、光軸のずれにより生じる FZP での光学収差の影響が無視できるようになった <sup>[2]</sup>,<sup>[3]</sup>,<sup>[4]</sup>。またマスクなどによるバックグラウンドの



図 1: FZP モニターの全体像

低減などの改良を施し、2004年には水平方向 50µm、 垂直方向 7µm 程度のビームサイズが安定に得られる ようになった<sup>[5]</sup>。但し、最近になり詳細測定を行う ことで、FZP モニターにて、100Hz のビーム位置の振 動が観測された。振動の振幅 (r.m.s) はビームに焼き 直して 5-6µm と大きく、FZP モニターのシャッター 開口時間 (20ms) ではビームサイズの測定を行う上で 無視できない。FZP や Si 分光器及び、CCD の振動を 振動計にて個々に調べた結果では振動のビームサイ ズ測定に対する影響は 1µm 以下であり、今のところ モニターから発生する振動ではない<sup>[5]</sup>。ただ振動の 原因はわかっていない。そのため、この振動の影響 を無視できるようにするために我々はシャッター時間 の短い新しいシャッター (開口時間 1ms 以下)の導入 を行った。

以下、新しいシャッターの性能評価、及び、新しい シャッターを用いたビームサイズ測定の結果と評価に ついて詳細を述べていく。

## 2. 新しいシャッターの性能評価



図 2: シャッター写真。

現在使用している CCD カメラは背面照射型を使用 しており、最小露光時間は 20ms である。フルフレー ム転送であるため、データ転送中に CCD 面に X 線 が入ることを防ぐ必要上、CCD の前面に配置された メカニカルシャッターとの同期により、データ転送 中の X 線を除去していた。前回までのシャッター開

<sup>\*</sup> E-mail: hrsakai@issp.u-tokyo.ac.jp

口時間は最小 6ms であったが、CCD の露光時間と同 期しており、実質最小 20ms で運転していた。但し、 6ms でも 100Hz 振動の除去は難しく、開口時間をよ り短かくするため新たにより口径の小さなシャッター ( $\phi$ 1mm)を採用した。またそれに応じて、CCD の改 良も行った。図 2 が今回導入した新しいメカニカル シャッター [UHS1ZM2 (Vincent 社)]である。コイル を用いた電磁シャッターであり、カタログ値で通常最 小 1ms のシャッター開口時間を有する。



図 3: 入力パルス幅に対するシャッター開口時間。

インストール前にシャッター開口時間の測定を行っ た。開口時間は送る TTL のパルス幅にて制御され、 シャッターの開閉を行う。開口時間の測定にはシャッ ターを通過するレーザーのシグナルを検知する方法 を用いた。図3がその測定結果である。TTL のパル ス幅(図3横軸)に比例して、開口時間(図3縦軸)が 変化しているのがわかる。また1ms以下では開口時 間は減少しなかった。但し、このシャッターは、通常 mode(Normal mode)以外に図2に示すように2つの コイルを用いる mode (High speed mode) があり、そ の場合には0.3msの開口時間を実現していた。

3. ビームプロファイル測定



図 4: FZP モニター模式図&ブロックダイアグラム。

新しいシャッターをインストールし、ビームプロ ファイル測定を行った。図4が FZP モニターの模式 図とそのブロックダイアグラムである。シャッターは FZP の間の焦点部分に近い場所に設置した。集光され た X線の幅はその場所では全幅でおよそ 300μm であ り、φ 1mm のシャッター開口部で問題ない。トリガー は電子ビームの入射と同期しており、digital delay を 経て、Function synthesizer にてシャッターと CCD 本 体に分配される。2つのトリガータイミング、パルス 幅は独立に変化させることが可能である。



図 5: 新しいシャッターによるビームプロファイル



新しいシャッターを導入した時のビームプロファイ ルを図5に示す。開口時間は1msであるが、クリア なビームプロファイルが得られた。このプロファイル が開口時間を変えることでどのように変化するかを 測定した。図 6、7 がそれぞれ開口時間を変化させた 時の水平方向、垂直方向のビームサイズの変化を示 す。開口時間の変化に対し、水平方向のビームサイ ズは変化しないのに対し、垂直方向は減少している のがわかる。100Hz 振動の影響と思われるため、開 口時間を 1ms に固定し、トリガータイミングを 2ms 毎変化させ、その時のビームプロファイルの位置の 変化を測定した。図8、9がそれぞれ水平、垂直方向 の CCD 上のビーム中心位置の変化である。トリガー タイミングに同期してビーム位置が変化した。図8、 9上で sin 関数にて ftt したところ 100Hz の振動であ ることがわかった。振幅はビームに焼き直してそれ ぞれ r.m.s にて 10µm、5.5µm であった。この振動の 影響で図7で開口時間が4ms以下から徐々に垂直方 向の測定サイズが小さくなっていくのがわかる。ま た、図7の測定後、トリガータイミングを図9から 最適化することで 1ms でも 0.3ms と同等のサイズが 得られ、振動の影響を無視できることが判明した。 シャッター開口時間を 1ms にして測定した結果の



妥当性を評価するため、測定場所のβ関数と分散関 数を測定し、ダンピングリングのlatticeからSADに て intra beam scattering の効果を入れた計算結果を用 いて、ビームサイズの比較を行った。図10、11がそ れぞれ水平、垂直方向の測定したビームサイズ(図 中の data)とSADから得られる計算値(図の実線 及び点線)との比較である。横軸はビーム電流。縦 軸がビームサイズを示す。測定結果はカップリング が0.3~0.6%の計算値の範囲内で水平、垂直共に合 致する。これと同時に測定したエネルギー幅の測定 結果(図12)も0.3~0.6%のカップリングの計算結果 の範囲内であり、3つの測定結果はカップリングが 0.3~0.6%の仮定の範囲内にて矛盾なく説明できる。



図 10: 水平方向ビームサイズと計算の比較。



図 11: 垂直方向ビームサイズと計算の比較。



図 12: 測定エネルギー幅と計算の比較。

### 4. 放射減衰時間の測定

FZP モニターは測定サイズのダイナミックレンジが 幅広くダンピングリングの放射減衰時間の測定に最 適である。なおかつシャッター開口時間が 1ms と小さ くなったため、より精度の良い測定行うことが可能と なった。今年から始まった wiggler を入れた運転では 減衰時間が短かくなる効果が予測されるため、その短 い減衰時間を測定し、wigglerを入れたダンピングリ ングの性能を評価することが重要である<sup>[6]</sup>。図13は それぞれ wiggler ありなしでの垂直方向の放射減衰時 間の測定結果である。横軸は入射からの時間、縦軸は 垂直方向のビームサイズを表している。図 13 の実線 にて fitting をした所、減衰時間は wiggler なし (off) で  $(30.9\pm0.6)$ ms、wiggler あり (on) で  $(20.7\pm0.8)$ ms と なり、減衰時間が小さくなる効果が測定されているの がわかった。また設計値はそれぞれ 28.5ms、21.1ms であり、測定結果とほぼ一致しているのがわかった。



図 13: 垂直方向の放射減衰時間の測定結果。

#### 5. 結論

新しいシャッターの導入を行いビームサイズ測定を 行った。1msのシャッター開口時間にてビームサイズ測 定を行い、100Hz 振動の除去が可能になり、測定の精 度が向上した。測定結果はカップリングを0.3~0.6% に仮定した計算結果と一致していた。また、ダンピ ングリングの放射減衰時間の測定結果は Wiggler あ りなしの場合にて設計値とほぼ一致していた。今後、 100Hz 振動の原因についてさらに調査する。

#### 参考文献

- [1] K.Iida, et. al., NIM A506 (2003) 41-49
- [2] T.Muto, et. al., "フレネルゾーンプレートを用いたビー ムプロファイルモニタの性能評価", in these proceedings.
- [3] T.Muto, et. al., Proc. of the 14th Symposium on Accelerator Science and Technology, Tsukuba, 2003, p476
- [4] M.Fujisawa, et. al., to be submitted to NIM A.
- [5] N.Nakamura, et. al., Proc. of EPAC04, Lucerne, 2004, p2353.
- [6] T.Naito, et. al., Proc. of PAC05, Knoxville, 2005, to be published.